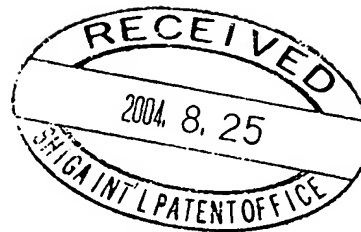


発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

出願人代理人
棚井 澄雄

あて名

〒 104-8543
東京都中央区八重洲2丁目3番1号

様

発送日
(日.月.年)

24. 8. 2004

出願人又は代理人
の書類記号 PC-9121

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号
PCT/J P 2004/007139

国際出願日
(日.月.年) 19. 05. 2004

優先日
(日.月.年) 20. 05. 2003

国際特許分類 (IPC) Int. Cl. G03F 7/039

出願人 (氏名又は名称)
東京応化工業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
☐ 第II欄 優先権
☒ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
☒ 第IV欄 発明の単一性の欠如
☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
☐ 第VI欄 ある種の引用文献
☐ 第VII欄 国際出願の不備
☒ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

10. 08. 2004

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
伊藤 裕美

2 H 9515

電話番号 03-3581-1101 内線 3230

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された P C T 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

1. 次に、次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により審査しない。

☒ 請求の範囲 3, 10-12, 15-22

☐ この国際出願又は請求の範囲 _____ は、国際予備審査をすることを要しない
次の事項を内容としている（具体的に記載すること）。

☐ 詳細については補充欄を参照すること。

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 追加手数料納付の求め(様式PCT/ISA/206)に対して、出願人は、

- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☒ 追加手数料の納付はなかった。

2. ☐ 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1、2、3、10、11、12、15に係る発明の共通の事項は、「酸の存在下でアルカリ性水溶液に対する溶解性が増大する」「樹脂」であり、特定のジビニルエーテル化合物との反応生成物である点である。

また、請求の範囲2、3、11、12、15に係る発明は、さらに、樹脂がポリヒドロキシスチレン系樹脂である点も共通している。

しかしながら、調査の結果、これらの共通する事項は、文献JP 2002-99090 A(信越化学工業株式会社) 2002.04.05, 請求の範囲, [0025]-[0026], [0042]-[0046], [0050]-[0052], [0080]に開示されているから、新規でないことが明らかとなった。

結果として、「酸の存在下でアルカリ性水溶液に対する溶解性が増大する」「樹脂」であり、特定のジビニルエーテル化合物との反応生成物である点、さらに、ポリヒドロキシスチレン系樹脂であることは先行技術の域を出ないから、PCT規則13.2の第2文の意味において、この共通事項は特別な技術的特徴ではない。

ここで、請求の範囲1、2に係る発明は、さらに、「酸の含有量が10 ppm以下である化学増幅型ポジ型ホトレジスト組成物」という共通事項を有する。

それ故、請求の範囲1、2、4、5に係る発明全てに共通の事項はない。

PCT規則13.2の第2文の意味において特別な技術的特徴と考えられる他の共通の事項は存在しないので、それらの相違する発明の間にPCT規則13.1の意味における技術的な関連を見いだすことはできない。

よって、請求の範囲1、3、10、11、12、15に係る発明は発明の単一性の要件を満たしていない。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

- ☐ すべての部分
- ☒ 請求の範囲 1, 2, 4-9, 13, 14 に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1, 2, 4-9, 13, 14	有 無
	請求の範囲		
進歩性 (IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1, 2, 4-9, 13, 14	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1, 2, 4-9, 13, 14	有 無
	請求の範囲		

2. 文献及び説明

文献1；JP 2002-99090 A (信越化学工業株式会社) 2002. 04. 05, 請求の範囲, [0025]-[0026], [0042]-[0046], [0050]-[0052], [0080] (ファミリーなし)

文献2；JP 10-204125 A (信越化学工業株式会社) 1998. 08. 04, 全文

&US 5942367 A &US 6114462 A

文献3；JP 10-207066 A (信越化学工業株式会社)

1998. 08. 07, 全文&US 5942367 A &US 6114462 A

文献4；JP 2001-109155 A (ジェイエスアール株式会社) 2001. 04. 20, 請求の範囲, [0057]-[0062], [0096] &US 6465150 B1

文献5；JP 2002-72477 A (ジェイエスアール株式会社) 2002. 03. 12, 請求の範囲, [0076]-[0086], [0114] &EP 1164433 A.1

文献6；JP 3-185448 A (日本合成ゴム株式会社) 1991. 08. 13, 特許請求の範囲, 第2頁左上欄第1-3行 (ファミリーなし)

文献7；JP 6-43651 A (日本合成ゴム株式会社) 1994. 02. 18, 請求項1, 2, [0004]-[0006] (ファミリーなし)

文献8；JP 9-68795 A (株式会社東芝) 1997. 03. 11, 全文 (ファミリーなし)

(請求の範囲1, 2, 4-6)

請求の範囲2, 4-6に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1-5により、請求の範囲1に記載された発明は、文献1により、進歩性を有しない。

文献1-5には、酸成分が10ppm以下であることは記載されていないが、化学増幅ポジ型レジスト組成物において、酸成分を低減させることは、技術常識であり (文献6-8参照)、本願程度に低減することは、必要に応じて、当業者が容易になし得ることである。

第Ⅳ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

(a) 請求の範囲 1 および 2 の「酸成分」が何を指すのか不明瞭である。

ヒドロキシスチレン単位も酸性分であるが、樹脂成分は除外されているのかも不明である。

(b) 請求の範囲 8 の「レジスト膜厚を 2 ～ 7 μm 程度の膜厚に形成する厚膜をフォトリソグラフィプロセスに用いられる」、請求の範囲 9 の「前記厚膜フォトリソグラフィプロセスは、インプランテーション用のレジストパターンを形成するためのものである」との記載は、化学増幅ポジ型レジストの構成をなんら規定するものではなく、発明に寄与する構成としては不明である。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

(請求の範囲 7)

請求の範囲 7 に記載された発明は、国際調査報告に記載された文献 1－5 により、進歩性を有しない。

γ－ブチロラク톤は、周知の溶媒であり、文献 4，5 にも記載されている。

(請求の範囲 8，9，13，14)

請求の範囲 8，9，13，14 に記載された発明は、国際調査報告に記載された文献 1－5 により、進歩性を有しない。

膜厚は必要に応じて適宜設定すべきである。